PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-183379

(43)Date of publication of application: 03,07,2003

(51)Int.Cl

COSG 64/30

(21)Application number (2001-381393)

(71)Applicant: TEIJIN LTD

(22)Date of filing:

14.12.2001

(72)Inventor: MINOBE TAKASHI

MATSUOKA YUKI SAWAKI TORU SASAKI KATSUJI

(54) METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING POLYCARBONATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a continuous manufacturing method of a polycarbonate resin capable of obtaining a polymer quality, a specially stable polymerization degree (a molecular weight in other words) and an end group content by using a transesterification method having no environmental issue and excellent in an economy.

SOLUTION: In the method where a raw material mixture is prepared by setting the mole ratio set value of a diester carbonate to an aromatic dihydroxy compound within a range of 1.0 to 1.1 and keeping accuracy of the mole ratio set value within ±0.005 is transesterified in a melted state to manufacture the aromatic polycarbonate, preparation of the raw material is performed by using two preparation tanks or more, and the accuracy of a mole ratio set value to the mole ratio set value is roughly controlled within ± 0.05 in a first preparation ank, and ank, the mole ratio of the raw material mixture obtained from a monomer preparation process is kept within ±0,005 to the mole ratio set value by measuring and supplying a trace according to a difference between the mole ratio of the diester carbonate in a melted state or the aromatic dihydroxy compound in a powder state in the preparation tank and the target mole ratio set value after a second preparation tank and subsequent tanks.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection)

[Date of extinction of right]

(18)日本国等新介(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出難公開番号 特開2003-183379 (P2003—183379A)

(43)公開日 平成15年7月3日(2009.7.3)

(51) Int.CL?

COSG 84/30

鐵別記号

テーマコード(参考)

C 0 8 G 64/30

41029

審査請求 未確求 請求要の数4 〇L (全 9 頁)

(21)出職番号

特欄2001-381393(P2001-381393)

(71)出版人 000003001

帝人株式会社

(22) 出版日

平成13年12月14日(2001, 12, 14)

大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号

(72)発明者 英濃部 隆

山口県岩関市日の田町2番1号 帝人株式

会社岩関研究センター内

(72)発明者 松岡 由記

山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式

会社岩関研究センター内

(74)代理人 100077263

弁理士 前田 純博

最終責に続く

(54) 【発明の名称】 ボリカーボネートの製造方法および装置

(57) (要約)

〔課題〕 環境問題を有せず、経済性に優れるエステル 交換法を用いてボリマー品質。特に安定した第合度(常 **い換えれば分子蟹)や末端基含有率を得ることができる** ボリカーボネート樹脂の連続的製造方法を提供する。

【解決手段】 芳香族ジヒドロキシ化合物に対する炭酸 ジエステルのモル比数定値を1、0~1、1の範囲に設 定し、且つ、該モル比数定饋の精度を±0.005以内 に維持して調製された原料混合物を溶融状態でエステル 交換せしめて芳香族ボリカーボネートを製造する方法に おいて、該原料混合物調製を2つ以上の調製槽を使用し て実施し、且つ、第1の調製槽において前記モル比較定 値に対しモル比級定値の程度を±0、05以内と粗調製 し、次いで第2の調製権以降に落酷状態の炭酸ジェステ ルまたは粉体状態の芳香族シヒドロキシ化合物を設調製 僧におけるモル比と目標とする前配モル比較定値との相 違に応じて微量計量供給することでモノマー調製工程が ら得られる原料混合物のモル比を前組モル比**設定値**に対 しまり、005以内の幾度に維持する。

1

[特許請求の範囲]

【請求項1】 芳善族ジヒトロキン化合物に対する炭酸ジエステルのモル比較定値を1、0~1、1の範囲に設定し、目つ、該モル比設定値の精度を±0、005以内に維持して調製された原料混合物を溶酸状態でエステル交換せしめて芳香族ボリカーボネートを製造する方法において、該原料混合物調製を2つ以上の調製槽を使用して実施し、目つ、第1の調製槽において前配モル比設定値に対しモル比設定値の精度を±0、05以内と粗調製し、次いで第2の調製槽以降に溶酸状態の炭酸ジエステ 10ルまたは粉体状態の芳香族ジヒドロキシ化合物を該調製槽におけるモル比と目標とする前記モル比設定値との相違に応じて微塵計量供給することでモノマー調製工程から得られる原料混合物のモル比を前記モル比設定値に対し±0、005以内の精度に維持することを特徴とするボリカーボネート樹脂の製造方法。

【請求項2】 モル比数定額に対してモル比数定額より 少なく、モル比数定額から-0、05より多い範囲に、 数定された値で溶験状態の炭酸シエステルを流量計量す ると共に、該モル比数定額に応じて数定された値で粉体 20 状態の芳香族ジヒドロキン化合物を重量計量し、連続的 に第1調製槽に供給、溶解し、次いで、第2の調製槽以 降の少なくとも1つの槽内のモル比を実測し、第2の調 製槽以降に設置した流量を可変制御できる微量流量計を 備えた溶酸状態の炭酸シエステル供給設備により炭酸シ エステルを追加供給し、該モル比数定値の精度を±0、 005以内に維持することを特徴とする請求項1記載の ボリカーボネート樹脂の製造方法。

【請求項3】 第2の調製槽の実測値に応じて第1の調 製槽に供給する炭酸ジェステルの量をモル比設定値より 30 も少なく、モル比設定値から-0.05より多い範囲内 に維持することを特徴とする請求項2記載のポリカーボ ネート樹脂の製造方法。

【請求項4】 第2の調整槽に微量供給する炭酸シエス テル又は芳香族ジヒドロキン化合物を1~60分の範囲 の時間間隔で、当該槽に起けるモル比測定値Aと維持し ようとするモル比すなわちモル比数定値Bとの間の偏 差、変化量及び変化速度を測定し、これに応じてPID 動作調節器により微量炭量または液量重量Cを自動制御 することにより第2の調整槽出側のモル比を制御して該 40 モル比較定値の精度を±0,005以内に維持すること を特徴とする特許額求の範囲第1項記載のポリカーボネート樹脂の製造方法。

【発明の詳細な説明】

(000F)

(発明の属する技術分野)本発明は、ボリカーボネート の製造方法に関するものであり、更に詳しくは、安定し たボリアー分子盤を得ることができるボリカーボネート の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ボリカーボネートは、耐衝撃性など機械 的特性に優れ、しかも耐熱性、透明性などにも優れてお り、広く用いられている。このようなボリカーボネート の製造方法としては、ビスフェノールなどの芳香族ジヒ ドロキシ化合物とホスケンとを直接反応させる方法(界 面法)、あるいはビスフェノールなどの芳香族ジヒドロ キシ化合物とジフェニルカーボネートなどの芳香族炭酸 ジエステルとを溶離状態でエステル交換反応(溶融法) させる方法が知られている。

【0003】このような製造方法の内、芳香族シヒトロキシ化合物と炭酸シエステルとのエステル交換反応によってポリカーボネートを製造する方法は、有毒なホスケンを使用せず。また溶剤としてステレンクロライトを使用しないため、環境問題を有しない製造方法でありかつ、コスト的にも安価にできる可能性を持つ製造方法として注目を集めている。しかしながらエステル交換反応によってポリカーボネートを連続的に製造する方法は界面法と比較した場合、ポリマー品質、特にポリマー分子最や末端の日基含有率の安定化が困難であるという問題を有していた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明では、環境問題を有せず、経済性に優れるエステル交換法を用いてボリマー品質、特に安定した重合度(言い換えれば分子量)や未端基合有率を得ることができるポリカーボネート樹脂の連続的製造方法の提供を目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は以下の通りである。

【0008】1、芳香族シヒドロキシ化合物に対する炭酸シエステルのモル比設定値を1、0~1、1に設定し、目つ、該モル比設定値の精度を±0、005以内に維持して調製された原料混合物を溶融状態でエステル交換せしめて芳香族ボリカーボネートを製造する方法において、該原料混合物調製を2つ以上の調製槽を使用して実施し、且つ、第1の調製槽において前配モル比設定値に対し該モル比設定値の精度を±0、05以内と相調製し、次いで第2の調製槽以降に溶融状態の炭酸シエステルまたは粉体状態の芳香族シヒドロキシ化合物を該調製槽におけるモル比と目標とする前記モル比設定値との相違に応じて微盤計量供給することでモノマー調製工程から得られる原料混合物のモル比を前記モル比設定値に対し±0、005以内の精度に維持することを特徴とするボリカーボネート樹脂の製造方法。

【0007】2. モル比設定値に対してモル比設定値より少なく、モル比設定値から-0.05より多い範囲に設定された値で溶融状態の炭酸ジエステルを流層計量すると共に、該モル比設定値に応じて設定された値で特体状態の芳香族ジセトロキシ化合物を重難計量し、連続的50 に第1の調製権に供給、溶解し、次いて、第2の調整権

以降の少なぐとも1つの槽内のモル比を実制し、第2の 顕整槽以降に設置した流量を可変制御できる微量流量計 を備えた溶酸状態の炭酸ジェステル供給設備により炭酸 ジエステルを追加供給し、該モル比設定値の精度を土 0.005以内に維持することを特徴とするボリカーボ ネート樹脂の製造方法。

[0008]3、第2の調製槽の実測値に応じて第1の 調製槽に供給する炭酸ジェステルの量をモル比設定値よ りも少なく、モル比較定値から-0.05より多い範囲 内に維持することを特徴とするポリカーボネート機能の 製造方法。

【0008】4、第2の調整槽に設量供給する炭酸シエ ステル又は芳香族ジヒドロキシ化合物を1~60分の範 囲の時間間隔で、当該槽におけるモル比測定値Aと維持 しようとするモル比すなわちモル比設定値Bとの間の健 差。変化量及び変化速度を測定し、これに応じてPID 動作調節器により微量流量または微量重量ごを自動制御 することにより第2の調整権比例のモル比を制御して該 モル比較定値の精度を±0.005以内に維持すること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載のポリカーボネ 20 一ト樹脂の製造方法である。

【0010】本発明のボイントはモル比の制御精度が土 0.005以内と非常に高い点である。該モル比精度が ±0.005以上になると引き続く薫合反応において反 応状態が不安定となり分子盤の安定したポリマーが得ら れなくなる。この原因はボリカーボネートの溶験重合か 原料として使用する芳香族シヒドロキシ化合物に起因す るセドロキシフェニル未端と芳香族炭酸ジェステルに起 因するフェニルカーボネート末端のエステル交換反応に よって進行し、得られるボリカーボネートの分子量の増 30 加に伴って反応系に存在するヒドロキシフェニル末端と フェニルカーボネート末端が減少する為、原料調整時の 僅かなモル比の変動が溶融重合の後期においてはヒドロ キシフェニル末端とフェニルカーボネート末端の存在割 合(未端蒸含有率)に大きな影響を及ばし、これによっ て重合速度が変化するためである。しかしながち、この ような高い精度に原料モル比を維持する事は多大な労力 とコストの増加を招き、特に連続的に高い精度で原料モ ル比を調整する事は困難であった。

【0011】このような現状に鑑み、問題を解決する為 40 がある。 区級意検討した結果、本発明者らは、原料調整を多数に 分け、第1種目で±0.1以内を粗調製し、第2権目以 **降で原料供給量を第1糟目に比べてかなり少なくする事** で原料モル比の調製精度を上げる方法をとればとり、0 り5以内にモル比を安定に制御できる事を見出し、本発 **明の方法を確立した。**

【0012】本発明の方法と従来の方法の相違を次に例 **巻挙げて異体的に示す。市販されている高精度計量器の** 計業精度は±1%以内が保証関係とされるか。このよう

る一度に計量を行う方法では原料調製槽第1槽目へ炭酸 ジエステルを毎時り、805キロモルと芳香族ジヒドロ キシ化合物を毎時0.5キロモルで第1櫓へ供給する場 合、目標モル比1.01に対してモル比が最大0.02 ずれる可能性がある。従って、このような高精度の計量 器をもってしても第1糟のみで確実に原料を±0.00 5以内に調製することはできない。これに対し、本発明 の組調整と精密調整を組み合わせた多段調整では、第1 椿で粗調整を行い、原料モル比が+0、02ずれていた とすると、第2種以降の精密調整で芳香族ジヒドロキシ 化合物を毎時0、01キロモル追添加し、また、相調整 でー0.02ずれていたとすると、精密調整で炭酸ジェ ステルを毎時0.01キロモル追溯加すればよい事にな る。追添加する計器の精度が±1%以内であれば、第2 |糟目以降における精密顕整のモル比のずれは±0.00 01であり±0,005以内の要求精度を十分に満たす。 ことになる。

【0013】このように本発明の多段原料機製方式をと れば更に厳密にモル比を制御する事が可能になり、ま た、別の見方をすれば計器の供給精度を±5%、±10 %に落としたとしても、十分に±0、0カ5以内の要求 精度を満たすことができる。

【0014】また、第1僧目での目標モル比を原料調整 の目標モル比よりもり、1程度下げる事で、第2槽目以 降で追添加する物質を炭酸ジェステルのみに絞る事も可 能となる。同様に目標モル比よりも0、1程度上げる事 で、第2糟買以降での追添加するものを芳香族シヒドロ キン化合物に絞る事も可能となる。このように道添加物 質を絞り込む場合。何れの物質に絞り込んでも良いが、 関体状態よりも溶融状態の方がパンドリング性に優れる 事 及び 芳香族シヒドロキン化合物は溶験状態で安定 性に欠ける場合がある事などから、溶融状態の炭酸ジェ ステルを道器加することが最も好ましい。

【0015】本発明に起いて、第2樽田均障でモル比を 実測し測定値に応じて通添加量を制御する上で、通添加 した炭酸ジエステル又は芳香族ジヒドロキシ化合物がオ ンラインモル比分析値に影響を及ばすには遅れ時間が生 ずるため、追添加する炭酸ジェステル又は芳香族ジヒド ロキン化合物の液量数定には、遅れ時間を考慮する必要

【0016】その遅れ時間は、本発明者の検討による と、遺跡加する物質や顕製権の大きさ等により変化する が1~60分であることが分かった。この知見に驀づ き、本発明の1.継続は1~60分の範囲の時間関隔で維 持しようとするモル比に対する偏差、変化量及び変化速 度を制定し、これに応じて、PID動作調節計を働かせ て追溯加する炭酸ジエステルあるいは芳香族ジヒドロキ シ氏合物の流量を設定して供給し、該流量設定の影響が 残る次の1~80分の間は診流量を維持する動作を繰り な高精度の計量器を使用したとしても、従来行われてい。50 蒸すことにより原料モル比を一定に制御することにより

構成される。

【0017】本発明で言う。 芳香族ポリカーボネートと は主たる成分である芳香族ジヒドロキン化合物と、炭酸 エステルとを塩基性窒素化合物とアルカリ金属化合物よ りなるエステル交換触媒等の存在下。溶融重縮合させた 芳香族ポリカーボネートである。

【0018】 鞍芳香族ジヒドロキン化合物としては、異 体的にはビス(4ーヒドロキシフェニル)メタン、2、 2ービス(4ーヒドロキジフェニル)プロバン、2、2 ービス(4 ーヒギロキシー3 ーメチルフェニル)プロバー10 ン、4、4ーピス(4ーヒドロキンフェニル)ヘブタ ン、2、2ービス(4ーヒドロキシー3。5ージクロロ フェニル)プロバン、2、2~ビス(4~ヒドロキシー 3. 5ージプロモフェニル)プロバン、ビス(4ーヒド ロキシフェニル) オギサイド、ピス(3、5ージクロロ …4…ヒドロキシフェニル)オキサイド。p、p′ージ ヒドロキシジフェニル。3、3′ージクロロー4、4′ ージヒドロキシジフェニル、ピス(ヒドロキシフェニ) (ル)スルホン、レゾルシノール。バイドロキッシ、1。 4-ジヒドロキシー2、5-ジクロロベンゼン、1,4 20 ージヒドロキシー3ーメチルベンゼン。ピス(4ーヒド ロキシフェニル)スルフィド。ピス(4ーヒドロキシフ ェニル)スルホキシド等が挙げられるが、特に2。2-ビス(4~ヒドロキシフェニル)プロバンが好速しい。 【1019】また炭酸ジェステルとしては、具体的には ジフェニルカーボネート。シトリールカーボネート。ビ ス(クロロフェニル)カーボネート。 血ーカレジルカー ボネート、ジナフチルガーボネート、ビス(ジフェニ ル) カーボネット、ジメチルカーボネート、ジエチルカ カーボネートなどが用いられるが、特にジフェニルカー ボネートが好ましい。

【0020】さちに、本発明のポリカーボネートには必 要に応じて、脂肪族ジオールとして、例えば、エチレン グサコール。主、4ープタンジオール、上。4ーシクロ ペキサンジメタノール。し、10一デカンジオール等。 を、ジカルボン酸類として、例えば、コバク酸。イソフ タル酸、2、6ーナフタレンジカルボン酸、アジビン 酸、シクロヘキサンカルボン酸、デレフルタ酸等:オキ 主ロキシー3ーナストエ勝等を含有していても良い。

【0021】本発明に用いられる触媒は特に限定されな いが、塩基性窒差化合物とアルカリ金属化合物わよびイ またはアルカリ土類金属化合物とよりなるエステル交換 触媒を使用することができる。

【0022】本発明で使用されるアルカリ金属および/ またはアルカリ主類金属化合物についても、得られる芳 香族ポリカーボネートの色相を低下させるものでなけれ は特に制限はなく薄々の公知のものを使用することがで \$-3°.

[0023] 触媒として用いられるアルカリ金属化合物 としては、例えばアルカリ金属の水酸化物、炭酸水素化 物 炭酸塩 酢酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、亜硫酸塩 ン アン酸塩、チオシアン酸塩、ステアリン酸塩、水素化ホ ウ素塩、安息香酸塩、リン酸水素化物。ビスフェノー ル、フェノールの塩等が挙げられる。

【0024】具体例としては、木酸化ナトリウム、木酸 化カリウム、水酸化リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭 酸水素カリウム、炭酸水素リチウム、炭酸ナトリウム。 炭酸カリウム、炭酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カ リウム、酢酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウ ム、硝酸リチウム、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウ ム、亜硝酸リチウム、亜硫酸ナトリウム。亜硫酸カリウ ム、亜硫酸リチウム、シアン酸ナトリウム。シアン酸カ リウム、シアン酸リチウム、チオシアン酸ナトリウム、 チオシアン酸カリウム。チオシアン酸リチウム。ステア リン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム。ステアリン 酸リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素カ リウム、水薬化ホウ素リチウム、フェニル化ホウ酸ナト リウム。安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息 書酸リチウム。リン酸水素ジナトリウム、リン酸水素ジ カリウム、ザン酸水素ジリチウム、ビスフェノールムの ジナトリウム塩、ジカリウム塩、ジリチウム塩、フェブ ールのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩などが挙 がられる。

【0025】触媒として用いられるアルカリ土類金蹊化 - 台物としては、例えばアルカリ土類金属の木酸化物。 炭 酸水类化物,炭酸塩、酢酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、亜硫 酸塩、シアン酸塩、チオシアン酸塩、ステアリン酸塩。 一ポネート、ジブチルカーボネート。ジンクロペキシル(36)安意香酸塩、ビスフェノール。フェノールの塩等が挙げ られる。

【0.02.8】異体例としては、水酸化カルシウム。水酸 化パリウム、水酸化ストロンチウム、炭酸水素カルシウ ム 炭酸水素パリウム、炭酸水素ストロンチウム 炭酸 カルンウム、炭酸バリウム、炭酸ストロンチウム、酢酸 カルシウム、酢酸バリウム、酢酸ストロンチウム、硝酸 カルンウム、硝酸パリウム、硝酸ストロンチウム、亜硝 酸カルシウム、亜硝酸バリウム、亜硝酸ストロンチウ ム、亜硫酸カルシウム、亜硫酸パリウム、亜硫酸ストロ ン鮻類例えば、楽歌、Pーヒキロキン安意養酸、8-ヒ 40 ンチウム、シアン酸カルシウム、シアン酸バリウム。シ アン酸ストロンチウム。チオシアン酸カルシウム、チオ シアン酸パリウム。チオシアン酸ストロンチウム、ステ アリン酸カルシウム、ステアリン酸パリウム、ステアリ ン数ストロンチウム。水素化ホウ素カルシウム、水素化 |本ウ素パリウム、本業化本ウ素ストロンチウム、安息番 酸カルシウム。安息香酸バリウム、安息香酸ストロンチ ウム、ピスフェメール者のカルシウム塩、バリウム塩、 ストロンチウム塩、フェノールのカルシウム塩。パリウ ム塩、ストロンチウム塩などが挙げられる。

- (0027) 本発明においては所望により、触媒のアル

カリ金属化合物として。(a) 周期律表第14族元素の アート結体のアルカリ金属塩または(b) 周期律表第1 4族元素のオキソ酸のアルカリ金属塩を用いることがで きる。ことで周期律表第14族の元素とは、ケイ素。ゲ ルマニウム、スズのことをいう。

【0028】(a) 周期率表第14族元素のアット結体 のアルカリ金属塩としては、特開平7-268091号 公報に配載のものをいうが、具体的には、ゲルマニウム (Ge) の化合物: NaGe (OMe) ... NaGe (OEt) .. NaGe (OPr) .. NaGe (OB. u), NaGe (OPh), Lige (OMe), LiGe (OBu)。LiGe (OPh),を挙げるこ とができる。

[0029]スズ(Sn)の化合物としては、NaSn (OMe), NaSa (OMe), (OEt), NaS n (OPr), NaSn (O-n-C,H,,), Na Sn (OMe), NaSn (OEt), NaSn (O Bu) .. NaSn (O-n-OnHm) .. NaSn (OEt), NaSa (OPb), NaSaBa 、(OMe)った挙げることができる。

[0030]また(b)周期律表第14族元素のオキソ 酸のアルカリ金属塩としては、倒えばケイ酸(sili cic acid)のアルカリ金属塩、スズ酸(sta nic acid)のアルカリ金属塩。ゲルマニウム (II) 酸 (sermanous acid) のアルカ り金属塩、グルマニウム (IV)酸 (germanic acid〉のアルカリ金属塩を好ましいものとして挙げ ることかできる。

【0031】ケイ酸のアルカリ金属塩は、例えばモノケ イ酸 (monosilione acid) またはその 30 縮合体の酸性あるいは中性アルカリ金属塩であり。その 例としては、オルトケイ酸モノナトリウム、オルトケイ 酸ジナトリウム、オルトケイ酸トリナトリウム、オルト ケイ酸テトラナトリウムを挙げることができる。

【0032】スズ酸のアルカリ金属塩は、例えばモノス ズ酸(monostanie acid)またはその縮 台体の酸性あるいは中性アルカリ金属塩であり、その例 としてはモンスズ酸ジナトリウム塩(Na,SnO,・X 日、〇、X=0~5)。モンスズ酸テトラナトリウム塩 《Ne.SnO.》を挙げることができる。

[0033] ゲルマニウム(11) 酸(sermano as acia)のアルカリ金護塩は、例えばモノゲル マニウム酸またはその縮合体の酸性あるには中性アルカ り金属塩であり、その粥としてはゲルヤニウム酸モノナ トリウム塩 (NaHGeO) を挙げるととができる。

【0034】がルマニウム(IV) 数 (german) ガーacid)のアルカリ金属塩は、例えばモノゲルマ 二ウム(LV)酸またはその縮合体の酸性あるいば中性。 アルカリ金属塩であり、その例としてはオルトゲルマニ

ニウム酸ジナトサウム塩 オルトゲルマニウム酸テトラ ナトリウム塩、ジゲルマニウム酸ジナトリウム塩(Na , G e , O ,)、テドラゲルマニウム酸ジナトリウム塩 《Na、Ge、O。)、ベンタゲルマニカム酸ジナトリウ ム塩(Na,Ge,On)を挙げることができる。

【0035】触媒としてのアルカリ金属化合物またはア ルカリ土類金属化合物は、当該触媒中のアルカリ金属元 素またはアルカリ土類金属元素が芳香族ジオール化合物 1モル当り1×10°*~5×10°当業となる割合で好 10 ましく使用される。より好ましい割合は同じ基準に対し 5×10~~1×10~当驚となる割合である。

【0038】当該触媒中のアルカリ金属元素量またはア ルカリ土類金属元素量が芳香族ジオール化合物1モル普 り1×10-%~5×10-%当盤の範囲を逸脱すると、得 られる芳香族ボリカーボネートの諸物性に悪影響を及ぼ
 し、また、エステル交換反応が充分に進行せず高分子量 の芳香族ボリカーホネートが得られない等の問題があり 好ましくない。

【0037】また、触媒としての含窒素塩基性化合物と 20 しては、例えばテトラメチルアンモニウムヒドロキンド (Me,NOH)、テトラエチルアンモニウムヒドロキ シキ(B·f.NOH)、テトラブチルアンモニウムヒド ロキシド(BolNOH)、ペンジルトリメチルアンモ ニウムヒドロ中シド($oldsymbol{\phi}$ = CH_{ϕ} \in $\mathrm{M}_{oldsymbol{\phi}}$ \in NOH \in \mathbb{N} キサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシドなどの アルキル、アリール、アルキルアリール基などを有する アンモニウムビドロオキシド類。ドリエチルアミン、下 リブチルアミン。ジメチルベンジルアミン、ヘキサデシ ルジメチルアミンなどの3級アミン類。あるいはチトラ メチルアンモニウムボロバイドライド (Mel, NB) 日、)、テトラズチルアンモニウムボロハイドライド (Bu。NBH。)、テトラブチルアンモニウムデトラフ ェニルボレート (Me, NBPh,)、テトラプチルアン

【0038】上記含窒素塩基性化合物は、含窒素塩基性 化合物中のアンモニウム窒素原子が芳香族ジオール化合 物1モル曲り1×10~~5×10~曲量となる割合で 用いるのが好ましい。より好ましい割合は囲む基準に対 46 し2×10 1~5×10 1 当業となる割合である。特に 好ましい割合は同じ基準に対し5×10m~5×10m 当堂となる割合である。

モニウムテトラフェニルボレート(Bu、NBPh、)な

どの塩基性塩を挙げることができる。

【りり39】なお、本願明細審において、仕込み芳香族 ジオール化合物(芳香族シヒドロキシ化合物ともいう) に対するアルカリ金属化合物。アルカリ土類金属化合 物、含窒素塩基性化合物の割合を、「芳香族ジヒドロキ シ化合物1モルに対し金属または塩基性窒素としてW (鉄値)当蟹の2(化合物名)蟹;として表現したが、 これは、例えば、名がナトリウムフェノキンドや2。2 ウム酸モノリチウム酸(t. i R, G e O, t まルトゲルマーsol ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロバンモノナトリ

ウム塩のようにナトリウム原干が一つであり、またはト リエチルアミンのように塩基性窒素が一つであれば、乙 の蟹がWモルに相当する量であることを意味し、2.2 ーピス(4 ーヒドロキシフェニル)プロバンジナトリウ ム塩のように二つであれば、W/2モルに相曲する量で あることを意味する。

【0040】本発明の重縮合反応には、上記触媒と一緒 に 必要により、周期律表第14族元素のオキソ酸わよ び同元素の酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1 種の助触媒を共存させることができる。

【0041】これら助触媒を特定の割合で用いることに より、末端の封鎖反応、重縮合反応速度を構なうことな く、重縮合反応中に生成し易い分岐反応や、成形加工時 における装置内での異物の生成、やけといった好まして ない副反応をより効果的に抑制することができる。

【0042】本発明において、芳香族シヒドロキン化合 物と炭酸シエステルとをエステル交換反応させる温度お よび圧力は特に制限が無く、反応が開始し、かつ、反応 で生成したモノヒドロキン化合物が反応系外に速やかに 除去される温度および圧力であれば如何なる条件でも良 20 いが、150℃~200℃の温度および4.0×10* Pa (30mmHg) %1. 333×10*Pa (10 OmmHg)の圧力で反応を開始した後、反応の進行に 伴うポリカーボネートの分子盤の増大に従って反応温度 を高め、反応圧力を低下させ、最終的には270~35 Oでの温度および1、333×10°Pa(1mmH g) 以下の圧力で反応を実施することが一般的である。 【0.0.43】更に詳しくは、ポリカーボネートの粘度平 均分子盤 (My) が1000~2000までの領域では 150~220°Cの温度および4、0×10'Pa(3 OmmHg)~1.333×10°Pa(100mmH g) の圧力で反応を実施し、M v が4000~6000 の領域では200~250℃。1、333×10′Pa $(10 \text{ mmHs}) \sim 1.333 \times 10^{4} \text{Pa} (100 \text{m})$ mHs)で反応を実施し、Myが10000を超える額 域では250~300℃、1.333×10°Pa(1 mm目を)以下で反応を実施することが好ましい。な お、使用する圧力の単位は特に記述しない限り全て絶対 歴である。

物と炭酸シエステルとをエステル交換せしのボリカーボ ネートを製造するために使用される設備およびプロセス に特に制限はなく、従来知られている設備やプロセスが 使用できるが、連続プロセスにおいて本税明の効果が特 に顕著に現れるため、連続プロセスは特に好きしい対応 である。

【0045】連続式の設備としては例えば 2 葉以上の 反応器を確例に設置し、隣接する反応器をバルフを備え 左顧響で接続し、反応液を移送するためのポンプを備え 最初の反応器に原料と触媒を連続的に供給し、最後の反 応器から所望の分子盤のポリカーボネートを連続的に接

き出すことにより実施される。

【0048】芳香族ジヒドロキシ化合物に対する炭酸ジ エステルのモル比は精霊塔の能力や反応器におけるモノ マーの反応率や。得ようとするポリカーポネートのOH 末端基策によって変化するが通常り、8~1、5好まし くは0.95~1.1更に好ましくは1.0~1.1が 使用される。

3.0 【0047】これらの設備に使用される機器の材質は特 に制限はないが、鉄の含有量の多い材質は避けるべきで あり、通常ニッケル。ステンレススチール等が好ましく が使用される。

【0048】 本発明で得られたポリカーボネートに触媒 失活剤を添加することもできる。

【0049】本発明に使用する触媒失活剤としては、公 知の触媒失活剤が有効に使用されるが、この中でもスル ホン酸のアンモニウム塩、ホスホニウム塩が好ましく。 更にドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニ ウム塩等のドデシルベンゼンスルホン酸の上配塩類やパ ラトルエンスルホン酸チトラブチルアンモニウム塩等の バラトルエンスルキン酸の上記塩類が好ましい。またス ルホン酸のエステルとしてペンゼンスルホン酸メチル。 ベンゼンスルボン酸エチル。ベンゼンスルホン酸ブチ ル、ペンゼンスルホン酸オクチル、ペンゼンスルホン酸 フェニル。パラトルエンスルホン酸メチル、パラトルエ ンスルホン酸エチル、パラトルエンスルホン酸プチル、 パラトルエンスルホン酸オクチル、パラトルエンスルホ ン酸フェニル等が好ましく用いられ、戯中、ドチンルベ 36 ンゼンスルホン酸テトラブチルホスポニウム塩が最も好 ましく使用される。

【0050】これらの触媒失活剤の使用酸はアルカリ金 選化合物わよび/またはアルカリ土類金属化合物より選 ばれた前記重合触媒1モル当たりり、5~50モルの割 合で、好ましくはり、5~10モルの割合で、更に好ま しくはり、8~5モルの割合で使用することができる。 【0051】これらの触媒失活剤は直接。または適当な 密剤に溶解または分散させて溶融状態のポリカーボネー Fに添加、混練する。このような操作を実施するのに用 【0044】本発明において、芳香族シヒドロキシ化台 40 いられる設備に特に制限は無いが、例えば2軸ルーダー 等が好ましく、触媒失活剤を溶剤に溶解または分散させ た場合はペント付きの2軸ルーターが特に好ましく使用

【0052】また本発明においては 本発明の目的を授 なわない範囲でボリカーボネートに添加剤を添加するこ とができる。この添加剤は触媒失活剤と同様に溶験状態 のポリカーボネートに添加することが好ましく。このよ うな添加剤としては、例えば、耐熱安定剤、ユポキン化 合物、紫外線吸収剤・離整剤、着色剤、スリップ剤、ア た設備を用い、各々の反応器を異なる条件に維持しつつ 50 ンチブロッキンダ剤、滑削、有機充壌剤、無機充壌剤等

度としてb値を用いた。

をあげることができる。

【0053】これらの内でも耐熱安定剤。紫外線吸収 剤、離型剤、着色剤等が特に一般的に使用され、これち は2種以上組み合わせて使用することができる。

【0054】本発明に用いられる耐熱安定剤としては、 例えば、隣化合物、フェノール系安定額。有機チオエー チル系安定剤。ヒンダードアミン系安定剤等を挙げるこ とができる。

【0055】また、紫外線吸収剤としては、一般的な繁 外線吸収剤が用いられ、例えば、サリチル酸系紫外線吸 10 収剤、ベンソフェノン系紫外線吸収剤、ベンザトリアゾ ール系禁外線吸収剤、シアノアクリレート系紫外線吸収 剤等を挙げることができる。

【0058】また鱶型剤としては一般的に知られた難型 剤を用いることができ、例えば、パラフィン類などの炭 (七水素系離型剤 ステアリン酸等の脂肪酸系離型剤 ス テアリン酸アミド等の脂肪酸アミド系離型剤。ステアリ ルアルコール、ペンタエリスリトール等のアルコール系 |離型剤|| グリセリンモノステアレート。ベンタエリスリ トールのステアレート等の脂肪酸エステル系離型剤、シー20 リコーンオイル等のシリコーン系離型剤等を挙げること ができる。

【0057】着色剤としては有機系や無機系の顔料や築 料を使用することができる。

【0058】これらの添加剤の添加方法に特に制限はな いが、例えば、直接ボリカーボネートに添加してもよ く、マスターペレットを作成して添加してもよい。

[0059]

【発明の効果】本発明の方法によれば、従来困難であっ た高精度の原料モル比調整を容易に、安定に実施すると 30 モノヒドロキン化合物と原料である炭酸ジエステルを分 とが可能となる。これによって溶験重合反応の変動を抑 制し、分子量変動とOH末端基含有率変動の小さいポリ カーボネートを製造する事が可能となる。また。本発明 は連続プロセスに特に有効であり、色相を始めとするボ リマー品質が向上したポリカーボネートを連続的に得る ととが可能となる。

[0080]

【実施例】以下実施例、比較例によって説明する。な お、この実施例は本発明を例示するためのものであり本 発明がこの実施例によって制限されるものではない。な 40 お、以下の実施例において得られたポリカーボネートの 物性は以下のようにして制定した。

腸有粘度及び粘度平均分子量

ひ. 7g/31の塩化メチレン溶液をウベローデ粘度計 を用い間有粘度測定し、次式により粘度平均分子量を末 数据。

[n]=1.23×10⁻¹M⁻¹

ボリカーボネートペレット(顕露×摄器×摄き(mm)= 2.5×3.3×3.0) のし、a、も額を日本戦色工業。

製ND-1001DPを用い反射法で測定し黄色度の尺

【0061】〔実施例1〕次のような反応設備を使用し て、芳香族ボリカーボネートの溶融重縮合を実施した。 **外部ジャケットを育する。溶離した炭酸ジェステルを貯** 留する炭酸シエステル貯槽、炭酸ジエステルをモノマー 混合物調製槽に供給することのできる炭酸ジェステル供 給ポンプ、芳香族ジヒドロキシ化合物の粉体を受け入れ る芳香族ジヒドロキシ化合物貯槽。ロードセル〈重量計 量器)を備え 配管の接続部分がすべてアラミド製の布 でできたフレキシブルな構造を有する芳香族ジヒドロキ シ化合物計量槽。芳香族シヒドロキシ化合物と炭酸ジェ ステルとをそれぞれ計量投入し加熱溶融・撹拌混合でき るモノマー混合物第1覇製槽、炭酸ジェステルを微量供 給しモル比を正確に調製する近赤外分析装置を備えた第 2調製槽、モノマー混合物第2調製権から調製された原 料を受け入れ、初期重合権に原料を連続的に定量供給す ることのできる原料ボンブを備えた原料供給権。重合触 媒を調整するための触媒調製槽、触媒調製槽から調製さ れた触媒溶液を受け入れ、初期無合槽に触媒溶液を定量 供給できる触媒ポンプを備えた触媒供給槽を付帯設備と して有する重合装置を用いて、連続的に溶験重縮合反応 を実施した。

【0062】炭酸ジェステル貯槽とモノマー混合物調製 槽をつなぐ配管には、外部ジャケットが付取してあり、 また、該配管にはマイクロモーション流量計とその指示 値によって開閉操作のできる自動弁。および配管内の炭 酸ジェステルの温度を測定する温度計を設置してある。

【0063】これらの初期重合槽には、反応で発生する 離する為の湮流機構を備えた精留塔を付設してある。

【0084】初期重合槽の反応液は、ギヤボンブによっ て、後期重合槽に連続的に供給する。

[0085]後期重合槽は、模型機件槽であって、精留 塔は有しておらず、シャケットが全体に付款されてい Ğ.,

【0066】後期整合槽を出た芳香族ポリカーボネート は、連続的にダイスより押出され、冷却バスでストラン 下とされた後、カッターによってペレットにされる。

【0087】落皺蔥縮台の運転条件を次に示した。芳香 族ジヒドロキシ化合物としてビスフェノール系、炭酸ジ エステルとしてジフェニルカーガネートを用いた。鎌倉 反応槽へ供給する前の。ジフェエルカーボネートとビス フェノールAとの混合物中のモル比級矩盤の目標値は、

1. 010とした。シフェニルカーボネート貯槽は、内 温を85±0.5℃に維持した。ジフェニルカーボネー 上貯槽とモフマー組合物調製槽をつなぐ配管の外部ジャ ケットには、30±0.5℃の温水を流した。

【0008】ます、シフェニルカーボネート貯槽から毎 50 時0.5キロモルの投入難設定でジフェニルカーボネー

3.4

投入量設定でジフェニルカーボネートを第1調製槽に供

トを第1調製物に供給した。供給中のジフェニルカーボー ネート貯槽とモノマー混合物調製槽をつなぐ配管の内温 は85±0。4°Cの範囲内であった。併せて、芳香族ジ モドロキン化合物貯槽から、芳香族ジヒドロキン化合物 計量槽へピスフェノールAを毎時り、5キロモルの計量 値設定で計量しなから第1調製槽へ供給した。第1調製 槽での滞留時間が20分となる様にレベル調製しなが ち、原料を第2覇製槽へ供給した。第2調製権にてモノ マー混合物中のジフェニルカーボネートとピスプェノー ルAのモル比率が1。01になる様に、ジフェニルカー。 ボネートを微量供給した。なお、原料モル比は、近赤外 分光法を用いて連続的に測定した。モル比を実測する上 て、遺添加した炭酸ジエステルのモル比に対する影響が 現れるには遅れ時間が生ずるため、本実施例では10分 の遅れ時間を考慮して制御を実施した。即ち、10分の 時間間隔で維持しようとするモル比に対する偏差、変化 量及び変化速度を制定し これに応じて、PID動作調 節計を働かせ追添加するジフェニルカーボネート流量を 設定して供給し、該流量設定の影響が残る10分の範囲 の時間は該流量を維持する動作を繰り返すことにより原 料モル比を一定に制御した。結果、原料モル比は1.0 10±0.005以内に運転期間を通して維持可能であ

(0.068) このようにして調整したモノマー混合物 を、原料供給権に移注した。

(0070) 集合触媒としては、テトラメチルアンモニウムヒトロキシドとピスフェノールAジナトリウム塩を用いた。触媒は、触媒調製槽において、触媒濃度が30pmとなるように、フェノール/ホ=90/10重量%の混合液に溶解した。このようにして調整した触媒溶液を、触媒供給物に移注した。

【0071】第1槽へDPC/BPAの混合原料をBPA換算で、毎時0、5キロモル及び触媒を原料流量に対し1%を定置供給し、500時間の連続溶融重合を実施した。

【0072】各重合権の運転条件は、初期重合権が、内 鑑210℃、真空度1、333×10°Pa(100m mHs)、中期重合権が、内温280℃、真空度2、0 ×10°Pa(15mmHs)、後期重合権が、270 で、真空度2、0×10°Pa(1,5mmHs)であった。

【0073】ポリカーボネートのサンブルは、2回/日 の頻度で後期重合権出口で採取し、品質評価した。結果 を表ー1に示した。

【0074】「実施例2」実施例1の反応設備において、原料目標モル比1、01は変えず、第1調製槽での 目標モル比を1、02として原料調製を行う。まず、ジ フェニルカーホネート幹槽から毎時0、51キロモルの

給した。供給中のシフェニルカーボネート貯稽とモノマ 混合物調製槽をつなく配管の内温は85±0.4℃の 範囲内であった。併せて、ビスフェノール入貯槽から。 ビスフェノールA計量槽へビスフェノールAを毎時0。 50キロモルの計量値設定で計量しながら第1調製槽へ 供給した。第1調製槽での滞留時間が20分となる様に レベル調製しながら、原料を第2調製槽へ供給した。 「0075】第2調製槽にてモノマー混合物中のジフェ 10 エルカーボネートとピスフェノールものモル比率がし、 Olicなる様に、ビスフェノールAを微量供給した。な お、原料モル比は、近赤外分光法を用いて連続的に測定 した。モル比を実測する上で、追添加したピスフェノー ル人のモル比に対する影響が現れるには遅れ時間が生ず るため、本実施例では15分の遅れ時間を考慮して制御 を実施した。即ち、15分の時間間隔で維持しようとす るモル比に対する偏差、変化量及び変化速度を測定し、 これに応じて、PID動作調節計を働かせ道添加するビ スフェノールA流量を設定して供給し、該流量設定の影 20 響が残る15分の範囲の時間は該流量を維持する動作を 繰り返すことにより原料モル比を一定に制御した。結 果、原料モル比は1.010±0.005以内に運転期

【0078】とのようにして調整したモノマー混合物 を、原料供給槽に移住し、実施例」と同じ反応設備、同 じ運転条件で500時間の連続溶験重合を実施した。 【0077】ポリカーボネートのサンブルは、2回/日 の頻度で後期重合槽出口で採取し、品質評価した。結果

間を通して維持可能であった。

を表一1に示した...

【0078】 [比較例] 実施例1の反応設備において、 ジフェニルカーボネートとピスフェノールAを第1槽に て1.01に調製するように流量数定し、第2槽以降で はジフェニルカーボネートとピスフェノールAどちらも 適加供給せずに原料モル比の分析のみを行った以外は実 施例1と同じ反応設備、同じ運転条件で500時間の連 統溶驗重合を実施した。モノマー混合物中のジフェニル カーボネートとピスフェノールAのモル比率を近赤外分 光法によって連続的に定置したところ。1.010± 0.02であった。

(6) 【0079】なお、モノマー混合物調製中のジフェニルカーボネート貯槽とモノマー混合物調製槽をつなぐ配管の内温は85±0、4°Cの範囲内であった。

【0080】ボリカーボネートのサンブルは、2回/日の頻度で後期重合諸出口で採取し、品質評価した。結果を表-1に示した。

[0081]

(表11

36

	原料基比	平均分子量	色相(b値)
突旋例… 1	1, 810±0, 005	15100~15300	-0.5~-0.2
実施例-2	1.010±0.005	15100~15300	-0.4~-0.2
it ø M	1,010±0,020	14980~15500	9,2~1,0

プロントページの続き

(72)発明書 佐脇 透

山口単岩圏市日の出町2番1号 希人株式

金社岩関研究センター内

(72)発明者 佐々木 勝町

山口興岩国市日の出町2番1号 帝人株式

会社岩国研究センター内

ドターム(参考) 43029 8A02 BA03 BA05 B804A

8805A 8809A 8812A 8812B 8004A 8F14A BC05X 8C07X 8G08X 8G24X 8H02 CA04 CA06 C805A C806A CC06A D807 D810 D812 EA05 EC05A EC08 HK0SA HC09 JA091 JA121 JA171 JA201 JA251 JA301 J8131 J8171 XC311 JC711 JF021 JF031 JF041 JE141 JF151 JF161 JF361 JF371 K802 K814 KC05

KEOZ KEOS